

Title (en)

Method for producing a two-sided high-pressure discharge lamp.

Title (de)

Verfahren zur Herstellung einer zweiseitigen Hochdruckentladungslampe.

Title (fr)

Procédé de préparation d'une lampe à décharge à haute pression à deux culots.

Publication

EP 0374677 A2 19900627 (DE)

Application

EP 89122831 A 19891211

Priority

DE 3842772 A 19881219

Abstract (en)

In the manufacture of a two-sided flattened metal halogenide high-pressure discharge lamp (20), the following process steps are carried out: preforming of the discharge vessel (6) by rolling with N₂ dynamic pressure rinse, clamping into a flattening device, introducing the first electro-optical system (8, 9, 10, 11), the power supply (10) being bent in a zig-zag shape and resting on the inner wall of the quartz tube (1) in a self-supporting fashion, manufacture of the first flattened portion (14) with Ar rinse, high-vacuum baking, clamping in the pump head with flattening device and filling in the filling substances (18, 19) and introducing the second electro-optical system (8, 9, 10, 11) through the metering valve in the pump head in the inert gas countercurrent, evacuating the heated-up discharge vessel (6) at least three times and argon-rinsing it, flooding the discharge vessel (6) with filler gas, manufacture of the second flattened portion (17) with simultaneous cooling of the discharge vessel (6), removal of the lamp (20) from the pump head and removal of the projecting ends of the quartz tube (1). The lamp (20) remains in the pump head during the entire pumping and flattening process, there is no pump tube on the discharge vessel (6). <IMAGE>

Abstract (de)

Zur Herstellung der zweiseitig gequetschten Metallhalogenidhochdruckentladungslampe (20) werden folgende Arbeitsgänge ausgeführt: Vorformen des Entladungsgefäßes (6) durch Einrollen mit N₂-Staudruckspülung, Einspannen in Quetschvorrichtung, Einführen des ersten Eo-Systems (8, 9, 10, 11), wobei die Stromzuführung (10) zickzackförmig geknickt und an der Innenwand des Quarzrohres (1) selbsthalternd abgestützt ist, Herstellen der ersten Quetschung (14) mit Ar-Spülung, Hochvakuumglühen, Einspannen in Pumpkopf mit Quetschvorrichtung und Einbringen der Füllsubstanzen (18, 19) und Einführen des zweiten Eo-Systems (8, 9, 10, 11) durch Dosierklappe im Pumpkopf im Edelgas-Gegenstrom, mindestens dreimaliges Evakuieren und Argonspülen des erwärmten Entladungsgefäßes (6), Fluten des Entladungsgefäßes (6) mit Füllgas, Herstellen der zweiten Quetschung (17) bei gleichzeitigem Kühlen des Entladungsgefäßes (6), Entnehmen der Lampe (20) aus dem Pumpkopf und Entfernen der überstehenden Enden des Quarzrohres (1). Lampe (20) bleibt während des gesamten Pump- und Quetschvorganges im Pumpkopf, kein Pumprohr am Entladungsgefäß (6).

IPC 1-7

H01J 9/24

IPC 8 full level

H01J 9/32 (2006.01); **H01J 9/24** (2006.01)

CPC (source: EP)

H01J 9/247 (2013.01)

Cited by

EP2309609A3; EP1246221A1; EP0591777A3; US5528101A; US8079763B2; WO2006077437A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

EP 0374677 A2 19900627; **EP 0374677 A3 19910508**; **EP 0374677 B1 19950329**; DD 290506 A5 19910529; DE 3842772 A1 19900621; DE 58909144 D1 19950504; HU 202674 B 19910328; HU 896662 D0 19900228; HU T52895 A 19900828; JP 2831404 B2 19981202; JP H02220328 A 19900903

DOCDB simple family (application)

EP 89122831 A 19891211; DD 33584789 A 19891218; DE 3842772 A 19881219; DE 58909144 T 19891211; HU 666289 A 19891218; JP 32751089 A 19891219